マイクロ波アシスト磁化反転と強磁性共鳴の 同一 Co/Pt ナノドット試料での測定

草薙勇作, 岡本 聡, 菊池伸明, 北上 修, 島津武仁 (東北大)

Relationship between microwave assisted magnetization switching and ferromagnetic resonance of Co/Pt nanodots.

Y. Kusanagi, S. Okamoto, N. Kikuchi, O. Kitakami, and T. Shimatsu

(Tohoku Univ.)

はじめに

マイクロ波アシスト磁化反転(MAS: Microwave Assisted magnetization Switching) は次世代超高密度記録技術の有力候 補として注目を集めている. MAS においては,磁気モーメントに GHz 帯域の交流磁場を印加することで磁気モーメント の歳差運動が誘起され,その結果反転磁場が大幅に低減される. 励起モードとしては,ドット径に依存して一様励起だけ でなく,高次のスピン波励起も MAS 挙動に大きく影響することが MAS 実験とシミュレーションの比較から分かってい る¹⁾. しかし,実際の励起モードと MAS 挙動の相関は実験的にはまだ確認されていない.本研究では励起モードと MAS 挙動の関係を調べるために,異常 Hall 効果による強磁性共鳴測定(AHE-FMR: Anomalous Hall Effect based Ferromagnetic Resonance)²⁾と MAS 実験を同一の Co/Pt ナノドット試料に対して行ったので,その結果について報告する.

実験方法と結果

実験に用いた膜構成は, MgO sub./Ta(2 nm)/Pt(25 nm)/[Co(1.1 nm)/Pt(0.5 nm)]₅/Pt(10 nm) とした. 成膜には DC マグネト ロンスパッタを用いた. この多層膜を EB リソグラフィにより加工し. 同一基板上にドットアレイを形成した. AHE 測 定用の電極およびマイクロ波交流磁場印加用の Cu 線路もあわせて形成した. ドットアレイのドット直径は 80~1000 nm でドット間距離は 60~200 nm とした. ドットアレイの配置領域は約 5×5 μm² である. MAS, FMR いずれの測定でも dc

磁場 H_{dc}を膜面に垂直に-6~6kOeの範囲で印加し、Cu線路に高周波電流 を印加し交流磁場 hf = 200 Oe を膜面内に印加した. AHE-FMR 測定では歳 差運動による磁化の垂直成分の変化を異常 Hall 電圧の変化量として検出す る. ただし,得られる信号が微弱であるため高周波電流を矩形波で振幅変 調し、同期した Hall 効果の変化をロックインアンプで検出した. Fig.1 に ドット直径 160 nm, ドット間距離 60 nm のドットアレイで得られた異常 Hall 電圧の変化量 Δ VAHE を示す. 交流磁場周波数 ff の増加に伴い高磁場側 にシフトする複数のディップが確認できる. 高磁場側のディップ (Fig.1 の▼)は一様モード (*m*=1),低磁場側のディップ (Fig.1の▽) は高次の モード (m=2) によるものである. Fig. 2 に AHE-FMR 測定より得られた 共鳴磁場 Hrと MAS 測定より得られた反転磁場 Hsw を交流磁場周波数 frの 関数として示す. 図中の H_{sw}のエラーバーは反転磁場の分散を表している. Hswはアシスト効果によりfrfの増加に伴い単調に減少しfrf=3~10 GHzの範 囲で最大 0.8 kOe の Hsw の低減が確認できた. これは過去に Co/Pt ナノドッ トで報告された結果¹に比べ小さな Hsw 減少であり、またブロードな MAS 挙動となっている.この原因としてはドット間距離が狭いことによる粒子 間相互作用の影響が考えられる. Hrは m = 1,2 いずれのモードも fr に対し て線形な変化を示しており、今回得られた MAS 効果は m=1 の一様モード の点線におおよそ対応する結果が得られた.

<u>参考文献</u>

- 1) M. Furuta et. al., J. Appl. Phys. 115, 133914 (2014).
- 2) N. Kikuchi et. al., Appl. Phys. Lett. 105, 242405 (2014).



Fig. 1 AHE voltage change ΔV_{AHE} as a function of dc field H_{dc}



Fig. 2 Resonance field H_r and switching field H_{sw} as a function of rf frequency f_{rf} .